

[本期目录] [下期目录] [过刊浏览] [高级检索]

[打印本页] [关闭]

## 软件、算法与仿真

基于Gabor相位和局部二值模式的AAM纹理表示

苏亚, 高新波, 王博, 王宇

(西安电子科技大学电子工程学院, 陕西 西安 710071)

摘要:

提出一种基于Gabor相位与局部二值模式 (local binary patterns, LBP) 算子的活动表观模型 (active appearance model, AAM)。与基于亮度的AAM相比, 改进模型在三个方面提高了算法性能: 提供多尺度多方向的Gabor纹理, 提高了模型的匹配精度; 增强了对外部环境变化 (如光照) 的鲁棒性; 基于LBP的纹理编码去除了大量冗余。实验结果表明该模型能够有效提高模型的匹配精度。

关键词: 活动表观模型 纹理建模 Gabor相位特征 局部二值模式

### Gabor phase and LBP based texture representation in AAM

SU Ya, GAO Xin-bo, WANG Bo, WANG Yu

(School of Electronic Engineering, Xidian Univ., Xi'an 710071, China)

Abstract:

An active appearance model(AAM) based on Gabor phase and local binary patterns(LBP) is presented. In comparison with the intensity based AAM, the proposed model improves the performance in three aspects: providing multi-scale and multi-direction Gabor texture which enhances the fitting accuracy of the model; improving the robustness to environmental changes, e.g., illumination; LBP based texture coding reduces a large amount of the redundancy. Experimental results on various datasets demonstrate that the proposed model can effectively improve the fitting accuracy.

Keywords: active appearance model texture modeling Gabor phase feature local binary pattern

收稿日期 修回日期 网络版发布日期

DOI: 10.3969/j.issn.1001-506X.2010.05.037

基金项目:

通讯作者:

作者简介:

作者Email:

参考文献:

本刊中的类似文章

Copyright by 系统工程与电子技术

扩展功能

本文信息

► Supporting info

► PDF([OKB](#))

► [HTML全文]

► 参考文献[PDF]

► 参考文献

服务与反馈

► 把本文推荐给朋友

► 加入我的书架

► 加入引用管理器

► 引用本文

► Email Alert

► 文章反馈

► 浏览反馈信息

本文关键词相关文章

► 活动表观模型

► 纹理建模

► Gabor相位特征

► 局部二值模式

本文作者相关文章

PubMed